

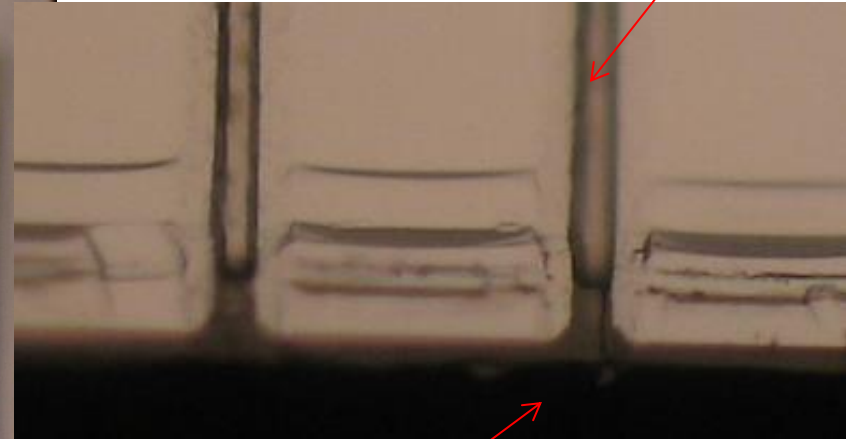
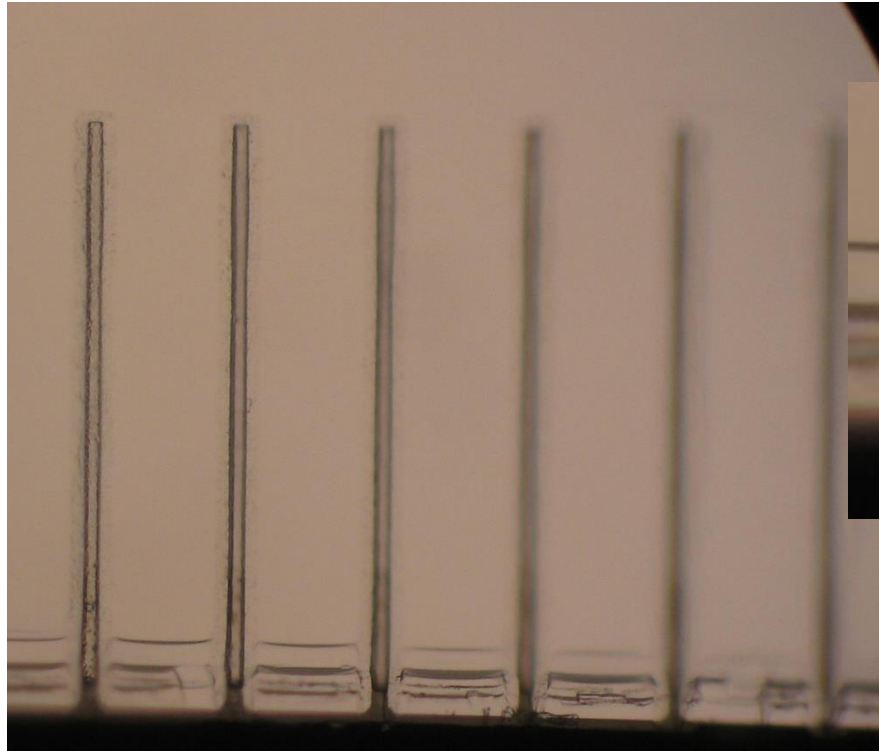
# Doppio DRIE

# Test

- Riempimento con poly 4 um
- Rimozione poly dalla superficie (ottimizzata ricetta nel DRIE)
- Coating con resist: varie prove. Al momento riesco a depositare solo 6 um di AZ; solo coating (senza esposizione)
- Simulazione di attacco DRIE

# Secondo DRIE

- Fori da 12micron;
- riempiti con poly;
- rimozione completa poly dalla superficie;
- deposizione resist;
- attacco DRIE 60 min SDE+ 15HER (fori 5 micron da 100micron)



resist

poly

# Secondo DRIE

60 min SDE+ 15HER (tempi necessari per arrivare con fori da 5 um passanti su 100 um)

